

自然科学研究機構分子科学研究所装置開発室装置有償利用等要項

平成25年9月30日

分子科学研究所長決定

(趣旨)

第1 この要項は、自然科学研究機構分子科学研究所（以下「研究所」という。）装置開発室で管理する装置の有償利用等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2 この要項において「装置の有償利用等」とは、研究所の装置を利用する者（以下「利用者」という。）が有償で別紙に掲げる装置を利用すること及び技術支援を受けることをいう。

(申請)

第3 利用者は、別紙の1から17までの装置については別記様式第1号による申請書を、文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業（以下「マテリアル事業」という。）の一環として管理する別紙の18から20までの装置については別記様式第2号又は第3号による申請書を、あらかじめ研究所長に提出しなければならない。

(許可)

第4 研究所長は、第3による申請書の提出があった場合は、装置開発室長及び関係者の意見を聴き、適当と認めたときは、別記様式第4号により、利用を許可するものとする。

(報告書)

第5 利用者は、別記様式第1号又は第3号の申請による装置の利用を終了したときは、別記様式第5号による報告書を、その終了の日から1カ月以内に研究所長に提出しなければならない。

2 利用者は、別記様式第2号の申請による装置の利用を終了したときは、研究所が別に指定する報告書を、研究所が別に指定する期日までに研究所長に提出しなければならない。

(実施確認)

第6 装置開発室の担当者は、別記様式第4号により許可した利用期間が1カ月以内の場合、利用者が装置の利用を終了したときは、速やかに別記様式第6号による実施確認書を研究所長に提出しなければならない。

2 装置開発室の担当者は、別記様式第4号により許可した利用期間が1カ月を超える場合、利用者が装置を利用した月において、その利用をすべて終了したときは、速

やかに別記様式第6号により、当該月分の実施確認書を研究所長に提出しなければならない。

(知的財産権の取扱い)

第7 利用者が、装置を利用して得られた研究成果による発明等に係る知的財産権（「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウ及びその他一切の知的財産権をいう。）の取扱いは、大学共同利用機関法人自然科学研究機構職務発明等規程（平成16年自機規程第12号）に定めるところによる。

(使用料等)

第8 利用者は、別に定めるところにより装置の使用料等を納付しなければならない。

(遵守事項)

第9 利用者は、研究所の規則、関係法令及び指示等を遵守するとともに安全の確保に努めなければならない。

(損害賠償)

第10 利用者は、故意又は重大な過失により、研究所の施設・設備等を滅失又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11 この要項の実施に関し必要な事項は、装置開発室長が別に定める。

附 則

この要項は、平成25年10月1日から施行する。

附 則

この要項は、平成26年7月1日から施行する。

附 則

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要項は、令和2年1月1日から施行する。

附 則

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要項は、令和4年11月28日から施行する。

附 則

この要項は、令和５年５月２３日から施行する。

附 則

この要項は、令和５年１２月１９日から施行する。

附 則

この要項は、令和６年９月９日から施行する。

附 則

この要項は、令和６年１２月１７日から施行する。

別紙

(装置)

	装置名称	メーカー、型式等
別記様式第 1 号による申請		
1	小型 2 源 R F スパッタ装置 (デポダウン式)	クライオバック RSP-4-RF3×2
2	NC フライス	マキノ AEV-74
3	C N C 旋盤	マザック SQT100MY
4	ワイヤー放電加工機	ファナック α-C400iB
5	5 軸同時加工機	ファナック α-D21LIB5
6	マシニングセンター	マキノ BN5-85A6
7	3 D 測定顕微鏡	オリンパス STM6DF
8	非接触 3 次元測定装置	三鷹 NH-3SP
9	プリント基板加工機	ACCURATE A427A
10	オシロスコープ	岩通 DS-5354
11	ファンクション・ジェネレータ	Tektronix AFG3251
12	卓上 NC フライス加工機	オリジナルマインド SR200
13	レーザーマーカ	Panasonic LP-GS051-L
14	L C R メータ	NF ZM2353
15	ロジックアナライザ	テクトロニクス TLA5201
以下、マテリアル事業の一環として管理する装置 (別記様式第 2 号または 3 号による申請)		
16	3 次元光学プロファイラ	ZYGO Nexview
17	マスクレス露光装置	ナノシステムソリューションズ DL-1000 (付属装置) スピンコーター ミサ MS-A100 段差計 KLA-Tencor P7
18	電子ビーム描画装置	エリオニクス ELS-G100

(技術支援)

区分	内容
技術開発	実験装置、制御機器等の開発、設計製図、製作、技術指導などを行う。
設計製作	実験部品、回路基板、マイクロデバイス等の設計製図、加工、製作、技術相談などを行う。
技術補助	機械、測定機、機器等の取扱説明・利用補助などを行う。

装置開発室装置有償利用申請書

年 月 日

大学共同利用機関法人自然科学研究機構
分子科学研究所長 殿

下記のとおり貴研究所の装置を有償利用したいので申請します。

また、実施にあたり、万一の傷害等の保障に関しては、申請者と申請者の所属機関
においてすべての責任を負うことを誓約します。

記

申請者	氏名	
	所属・職名	
	住所	〒
	連絡先	TEL e-mail
研究課題名		
利用希望装置	①	
	②	
	③	
	④	
利用希望期間		年 月 日 ～ 年 月 日
利用希望時間数 ※利用希望装置毎に記入 すること	①	時間
	②	時間
	③	時間
	④	時間
放射線業務従事		☐ 有 (注) 有の場合は「放射線業務従事承認書」を提出してください。 ☐ 無
寒剤の利用		ヘリウム： ☐ 有 ☐ 無 窒素： ☐ 有 ☐ 無
利用の目的		

利用の具体的方法				
共同利用研究者		氏名	所属	職名
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
不正防止に関する誓約	申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、以下のガイドライン等を理解し、これらのガイドライン・方針・規程、自身が所属する機関の規則、関連する法令等を遵守し、研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）、及びそれ以外の不正行為（不適切なオーサiership、二重投稿等）を行いません。 （１）研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成２６年８月２６日文科科学大臣決定） http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/_icsFiles/afiedfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf （２）大学共同利用機関法人自然科学研究機構研究活動上の不正行為を防止するための基本方針（平成２０年２月２８日決定） https://www.nins.jp/open/post_8.html （３）大学共同利用機関法人自然科学研究機構における研究活動上の不正行為への対応に関する規程（平成２０年２月２８日自機規程第７４号） https://www.nins.jp/open/3157.pdf 以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。 ☐ 誓約します。			
安全管理に関する誓約	申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、分子科学研究所安全ガイド（https://www.ims.ac.jp/about/safetyguide2021_2022.pdf）を理解し、これらのガイドライン、自身が所属する機関の規則、労働安全衛生法等の関連する法令等を遵守し、安全と環境を常に意識しながら、研究活動における事故・災害の発生防止に努めます。 以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。 ☐ 誓約します。			
希望事項				
その他	請求書の送付先が「申請者」欄の記載情報と異なる場合は、こちらに記載ください。 請求書に記載する宛名・住所： 請求書の送付先E-mail又は住所・ご担当者名： 請求書は、原則公印を省略し、E-mailで送付します。特に公印を押印した紙媒体の請求書が必要な場合は、以下にチェックを入れてください。 ☐ 請求書に公印の押印が必要			

申請者の所属機関における承認（※）	承認者氏名	
	所属・部署	
	職名（役職）	

※申請者の所属機関が本申請を承認していることについてご記入ください。

記載不要

確認者	確認日付	氏 名	区分	職員対応時間（見込）
装置開発室長	年 月 日		☐ 技術開発	
担 当 者	年 月 日		☐ 設計製作	
			☐ 技術補助	

装置開発室装置有償利用申請書（マテリアル事業成果公開）

年 月 日

大学共同利用機関法人自然科学研究機構
分子科学研究所長 殿

下記のとおり貴研究所の装置を有償利用したいので申請します。

また、実施にあたり、万一の傷害等の保障に関しては、申請者と申請者の所属機関においてすべての責任を負うことを誓約します。

記

申請者	氏名	
	所属・職名	
	住所	〒
	連絡先	TEL e-mail
企業種別（※）		☐ 大企業 ☐ 中小企業 ☐ その他
分野・業種等（※）		（1～25のうち該当する番号を記入）
*・・・本様式末尾記載の基準及び一覧から選択すること		
研究課題名		
利用希望装置	①	
	②	
	③	
	④	
利用希望期間		年 月 日 ～ 年 月 日
利用希望時間数 ※利用希望装置毎に記入 すること	①	時間
	②	時間
	③	時間
	④	時間
放射線業務従事		☐ 有 （注）有 の場合は「放射線業務従事承認書」を提出してください。 ☐ 無

研究目的と実施計画	各項目についてA4判縦1枚（2ページ）に入るように記述し、添付してください。 1）研究目的（500～1000字程度） 分子科学における当研究の意義付けを含めて、平易かつ簡潔に記載してください。 継続して申請する場合、これまでの研究経緯と本研究で新規に目指す内容について具体的に記載してください。 2）研究の実施計画（1000字～2000字程度） この研究を分子科学研究所で実施することの必要性を含めて、具体的に記入してください。			
申請者の所属機関における承認 (申請者の所属機関が本申請を承認していることについてご記入ください。)	承認者氏名			
	所属・部署			
	職名(役職)			
共同利用研究者 (上限5名まで)		氏名	所属	職名
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
不正防止に関する誓約	申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、以下のガイドライン等を理解し、これらのガイドライン・方針・規程、自身が所属する機関の規則、関連する法令等を遵守し、研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）、及びそれ以外の不正行為（不適切なオーサiership、二重投稿等）を行いません。 （1）研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成26年8月26日文科科学大臣決定） https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/_icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf （2）大学共同利用機関法人自然科学研究機構研究活動上の不正行為を防止するための基本方針（平成20年2月28日決定） https://www.nins.jp/open/post_8.html （3）大学共同利用機関法人自然科学研究機構における研究活動上の不正行為への対応に関する規程（平成20年2月28日自機規程第74号） https://www.nins.jp/open/3157.pdf 以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。 ☐ 誓約します。			
安全管理に関する誓約	申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、分子科学研究所安全ガイド (https://www.ims.ac.jp/about/safetyguide2021_2022.pdf) を理解し、これらのガイドライン、自身が所属する機関の規則、労働安全衛生法等の関連する法令等を遵守し、安全と環境を常に意識しながら、研究活動における事故・災害の発生防止に努めます。 以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。 ☐ 誓約します。			
マテリアル先端リサーチインフラ施設及び設備利用約款に関する承諾	申請者及び共同利用研究者は、本研究所の装置の有償利用にあたり、マテリアルリサーチインフラ施設及び設備利用約款 (https://arim.ims.ac.jp/wp-content/uploads/contract.pdf) に承諾していただく必要があります。 約款について、承諾する場合はチェックを入れてください。 ☐ 承諾します。			
マテリアル先端リサーチインフラデータ登録約款	申請者及び共同利用研究者は、本研究所の装置の有償利用にあたり、マテリアルリサーチインフラデータ登録約款 (https://arim.ims.ac.jp/wp-content/uploads/data_registration.pdf) に承諾していただく必要があります。			

一タ登録約款に関する承諾	約款について、承諾する場合はチェックを入れてください。 ☐ 承諾します。
DICEアカウント取得の確認	申請者及び共同利用研究者は、本研究所の装置の有償利用にあたり、材料データプラットフォーム（DICE）のアカウント（ https://dice.nims.go.jp/usage.html ）を取得していただく必要があります。 DICEアカウントについて、取得した場合はチェックを入れてください。 ☐ 取得しました。
希望事項	
その他	請求書の送付先が「申請者」欄の記載情報と異なる場合は、こちらに記載ください。 請求書に記載する宛名・住所： 請求書の送付先E-mail又は住所・ご担当者名： 請求書は、原則公印を省略し、E-mailで送付します。特に公印を押印した紙媒体の請求書が必要な場合は、以下にチェックを入れてください。 ☐ 請求書に公印の押印が必要

記載不要	確認者	確認日付	氏 名	区分	職員対応時間（見込）
	装置開発室長	年 月 日		☐ 技術開発	
	担 当 者	年 月 日		☐ 設計製作	
				☐ 技術補助	

【企業種別基準】

大企業 資本金3億円以上または従業員300人以上のどちらかに該当するもの
 中小企業 資本金3億円以上または従業員300人以上のどちらにも該当しないもの
 その他 上記に該当しないもの

【分野・業種等一覧】

1 有機材料／2 電子・磁性・金属・無機材料／3 繊維・窯業・紙・パルプ／4 食品・飲料／5 化粧品・トイレタリー／6 医療・医薬品／7 精密機器・産業機械製造業／8 医療機器製造業／9 分析・計測機器／10 電気・電子機器・総合電機／11 半導体・電子部品製造業／12 自動車・輸送・運輸機器・部品製造業／13 鉄鋼・非鉄金属製造業／14 商社・代理店・流通・小売業／15 電力・ガス・石油・その他エネルギー／16 建設・不動産／17 情報・通信／18 金融・投資・コンサルティング／19 シンクタンク／20 水産・農林・鉱業／21 報道・メディア・出版／22 外国公館・機関・団体／23 官公庁・自治体・地方公共団体／24 教育・研究機関／25 その他

装置開発室装置有償利用申請書（マテリアル成果非公開）

年 月 日

大学共同利用機関法人自然科学研究機構
分子科学研究所長 殿

下記のとおり貴研究所の装置を有償利用したいので申請します。

また、実施にあたり、万一の傷害等の保障に関しては、申請者と申請者の所属機関においてすべての責任を負うことを誓約します。

記

申請者	氏名	
	所属・職名	
	住所	〒
	連絡先	TEL e-mail
企業種別（※）		☐ 大企業 ☐ 中小企業 ☐ その他
分野・業種等（※）		（1～25のうち該当する番号を記入）
*・・・本様式末尾記載の基準及び一覧から選択すること		
研究課題名		
利用希望装置	①	
	②	
	③	
	④	
利用希望期間		年 月 日 ～ 年 月 日
利用希望時間数 ※利用希望装置毎に記入 すること	①	時間
	②	時間
	③	時間
	④	時間
放射線業務従事		☐ 有 （注）有の場合は「放射線業務従事承認書」を提出してください。 ☐ 無

研究の具体的方法				
申請者の所属機関における承認 (申請者の所属機関が本申請を承認していることについてご記入ください。)	承認者氏名			
	所属・部署			
	職名(役職)			
共同利用研究者 (上限5名まで)		氏名	所属	職名
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
不正防止に関する誓約	申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、以下のガイドライン等を理解し、これらのガイドライン・方針・規程、自身が所属する機関の規則、関連する法令等を遵守し、研究活動における特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)、及びそれ以外の不正行為(不適切なオーサiership、二重投稿等)を行いません。 (1) 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定) https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/_icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf (2) 大学共同利用機関法人自然科学研究機構研究活動上の不正行為を防止するための基本方針(平成20年2月28日決定) https://www.nins.jp/open/post_8.html (3) 大学共同利用機関法人自然科学研究機構における研究活動上の不正行為への対応に関する規程(平成20年2月28日自機規程第74号) https://www.nins.jp/open/3157.pdf 以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。 ☐ 誓約します。			
安全管理に関する誓約	申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、分子科学研究所安全ガイド(https://www.ims.ac.jp/about/safetyguide2021_2022.pdf)を理解し、これらのガイドライン、自身が所属する機関の規則、労働安全衛生法等の関連する法令等を遵守し、安全と環境を常に意識しながら、研究活動における事故・災害の発生防止に努めます。 以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。 ☐ 誓約します。			
希望事項				
その他	請求書の送付先が「申請者」欄の記載情報と異なる場合は、こちらに記載ください。 請求書に記載する宛名・住所： 請求書の送付先E-mail又は住所・ご担当者名： 請求書は、原則公印を省略し、E-mailで送付します。特に公印を押印した紙媒体の請求書が必要な場合は、以下にチェックを入れてください。 ☐ 請求書に公印の押印が必要			

：記

確認者	確認日付	氏名	区分	職員対応時間(見込)
-----	------	----	----	------------

装置開発室長	年 月 日		☐ 技術開発	
担 当 者	年 月 日		☐ 設計製作	
			☐ 技術補助	

【企業種別基準】

大企業 資本金 3 億円以上または従業員 3 0 0 人以上のどちらかに該当するもの

中小企業 資本金 3 億円以上または従業員 3 0 0 人以上のどちらにも該当しないもの

その他 上記に該当しないもの

【分野・業種等一覧】

1 有機材料／2 電子・磁性・金属・無機材料／3 繊維・窯業・紙・パルプ／4 食品・飲料／5 化粧品・トイレタリー／6 医療・医薬品／7 精密機器・産業機械製造業／8 医療機器製造業／9 分析・計測機器／10 電気・電子機器・総合電機／11 半導体・電子部品製造業／12 自動車・輸送・運輸機器・部品製造業／13 鉄鋼・非鉄金属製造業／14 商社・代理店・流通・小売業／15 電力・ガス・石油・その他エネルギー／16 建設・不動産／17 情報・通信／18 金融・投資・コンサルティング／19 シンクタンク／20 水産・農林・鉱業／21 報道・メディア・出版／22 外国公館・機関・団体／23 官公庁・自治体・地方公共団体／24 教育・研究機関／25 その他

別記様式第4号

装置開発室装置有償利用許可書

年 月 日

大学共同利用機関法人自然科学研究機構
分子科学研究所長

下記のとおり、装置開発室装置有償利用を許可します。

記

利用者（申請者）	
利用者所属	
共同利用研究者人数	
課題番号	
研究課題名	
利用装置	
利用期間	
利用時間数又は日数	
使用料（見込み）	円（消費税込） ※この金額は見込みであり、実際の使用料は請求書により別途通知します。 （内訳）
許可条件	① 利用に当たっては、善良な管理者の注意をもって当てること。 ② 第三者に貸与しないこと。 ③ 実験施設を破損したときは、損害賠償を行うこと。 ④ その他使用に当たっては、研究所の指示に従うこと。
その他	① 使用に当たり、研究所の指示に従わない場合においては、利用許可を取り消すことができるものとする。 その場合、既利用分については使用料を支払わなければならない。 ② 成果非公開の場合を除き、装置開発室又はマテリアル事業担当者の指示に従い、利用報告書を期限までに提出すること。

装置開発室装置利用報告書

年 月 日

分子科学研究所長 殿

報告者 所 属 :
職 名 :
氏 名 :

下記のとおり装置の利用結果を報告します。

記

利用した装置 :

研究課題名 :

課題番号 :

共同利用研究者 : (所属・職名・氏名)

利用日 : 年 月 日 ~ 年 月 日
(実際に利用した日付をご記入ください。)

分子研担当者 :

利用内容 :

記載不要

確認者	確認日付	氏 名	区分	職員対応時間 (見込)
装置開発室長	年 月 日		☐ 技術開発	
担 当 者	年 月 日		☐ 設計製作	
			☐ 技術補助	

別記様式第 6 号

装置開発室装置有償利用の実施確認について

年 月 日

確認者（装置開発室担当者）

所属

職名

氏名

下記のとおり、装置開発室装置有償利用を実施したことを確認しました。

記

利用者（申請者）			
利用者所属			
共同研究者を含めた 装置の利用人数	人		
研究課題名			
課題番号			
利用装置			
利用期間 (不連続の場合は全て記入)	開始： 年 月 日 時 分 終了： 年 月 日 時 分		
利用日数及び時間数			
区分／担当者 ／職員対応時間数	技術開発	担当者：	時間
	設計製作	担当者：	時間
	技術補助	担当者：	時間
その他			